【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成29年7月13日(2017.7.13)

【公表番号】特表2016-540193(P2016-540193A)
【公表日】平成28年12月22日(2016.12.22)
【年通号数】公開・登録公報2016-069
【出願番号】特願2016-521639(P2016-521639)
【国際特許分類】
Ｇ０１Ｎ　15/06　(2006.01)
Ｆ０１Ｎ　3/023　(2006.01)
Ｆ０１Ｎ　3/28　(2006.01)
Ｆ０１Ｎ　3/10　(2006.01)
Ｆ０１Ｎ　11/00　(2006.01)
Ｇ０１Ｎ　1/22　(2006.01)
Ｇ０１Ｎ　1/02　(2006.01)
Ｂ０１Ｊ　23/58　(2006.01)
Ｂ０１Ｄ　53/94　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｇ０１Ｎ　15/06　Ｄ
Ｆ０１Ｎ　3/023　Ｋ
Ｆ０１Ｎ　3/023　Ｅ
Ｆ０１Ｎ　3/28　３０１Ｐ
Ｆ０１Ｎ　3/10　Ａ
Ｆ０１Ｎ　11/00
Ｇ０１Ｎ　1/22　Ｒ
Ｇ０１Ｎ　1/02　Ａ
Ｂ０１Ｊ　23/58　Ａ
Ｂ０１Ｄ　53/94　２４１

【手続補正書】
【提出日】平成29年6月5日(2017.6.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
ナノ粒子カウンタデバイスの前段にガス処理ステージを有する、改良されたナノ粒子カウンタ装置であって、前記ガス処理ステージは、酸化触媒と、ガス状硫黄化合物と、望ましくは、冷却されたときに、核形成して粒子を形成する窒素酸化物とを吸収するのに効果的な吸収体と、を備え、前記ガス処理ステージは、１以上の透過モノリス上に支持され、前記ガス処理ステージは、４００セル／二乗インチより多くなく、５０ミクロンより多くないホイル厚さを有し、少なくとも９０％の開口面積を有する金属ホイルモノリス上に支持される、装置。
【請求項２】
前記モノリスホイル厚さは、２０ミクロンより多くない、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
前記ガス処理ステージは、プラチナ、パラジウム、ロジウム及び金、及び、それらの混

合物から選択された触媒を含む、請求項１又は２に記載の装置。
【請求項４】
前記ガス処理ステージは、アルカリ金属化合物、及び、アルカリ土類金属化合物から選択される吸収体を含む、上記請求項のいずれか１項に記載の装置。
【請求項５】
前記ガス処理ステージは、触媒と吸収体が混合された、ダウンストリーム領域を含む、上記請求項のいずれか1項に記載の装置。
【請求項６】
前記ガス処理ステージは、酸化触媒の内部層と吸収体の外部層とを有する区域を含む、上記請求項のいずれか1項に記載の装置。
【請求項７】
粒子カウンタ装置を用いる排気ガスストリーム内の固体粒子の数を計数する方法であって、揮発性有機物質を酸化することと、続いて、上記請求項のいずれか1項に記載のユニットを用いて、ガス相から硫黄物質を吸収すること、を含むガス処理ステップを含む、方法。